

結晶加工と評価技術 第 145 委員会 第 89 回研究会 開催通知

- (1) 日時 平成 14 年 8 月 20 (火) 13 : 30 - 21 (水) 11 : 10
(2) 場所 淡路夢舞台 国際会議場
兵庫県津名郡東浦町夢舞台一番地 TEL:0799-74-1020, FAX:0799-74-1021
新神戸、三宮、舞子などから高速バス
(3) 研究会 テーマ「SOI ウェーハ技術の現状と SOI デバイスの動向」
世話人 岸野正剛 (姫路工大)

趣旨 これまで下火であった SOI/LSI 技術が、現在俄かに脚光を浴びている。半導体デバイス技術の救世主という説もある。デバイス製造については、これまで日本では遅れていたがいよいよ始まりつつある。本格的な製造開始もまもなくであろう。この時期に合わせて、SOI ウェーハ技術の現状と SOI デバイスの動向に視点を当てて研究会を開くことにした。評価技術は現在進行中の (学振の) 未来開拓研究プロジェクトの成果も含めて、国内外の状況を講演して頂くことにした。SOI ウェーハ材料については SIMOX、UNIBOND、および、ELTRAN について最近の状況をメーカーの方から講演していただく。多彩な研究者の参加を頂いて活発な討論を予定している。なお、講演は一部を海外の招待講演者をお願いする関係もあり、英語もありますが、基本的には日本語中心で行います。

スケジュール

第一日 { 8/20 (火) }

第 I 部 司会 岸野 正剛 (姫路工大・大学院)

- | | | | |
|-------------|---------|-------------------------|-------------------|
| 1 . 13 : 30 | 13 : 35 | 開会の挨拶 | 梅野正隆 第 145 委員会委員長 |
| 2 . 13 : 35 | 14 : 05 | ケルビンー光起電力法による非接触評価 | 奥村 次徳 (都立大・大学院) |
| 3 . 14 : 05 | 14 : 35 | SOI ウェーハのマクロ&ミクロ C V 評価 | 吉田晴彦 (姫路工大・大学院) |
| 4 . 14 : 35 | 15 : 05 | X 線による評価 | 志村 孝功 (阪大・大学院) |

休憩 (15 : 05 15 : 20)

第 II 部 司会 泉 勝俊 (阪府大・大学院)

- | | | | |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| 5 . 15 : 20 | 16 : 10 | SOI Device: Present and Future | S.R. Cristoloveanu (ENSERG) |
| 6 . 16 : 10 | 16 : 45 | フォトルミネッセンスに依る評価 | 田島道夫 (宇宙科学研) |
| 7 . 16 : 45 | 17 : 20 | ELTRAN | 伊佐治 弘 (キャノン) |

懇親会 18 : 00 19 : 30 於淡路夢舞台 (会費 ¥ 2,000 円)

第二日 { 8/21 (水) }

第 III 部 司会 奥村 次徳 (都立大・大学院) { または 益子洋治 (三菱電機) }

- | | | | |
|--------------|---------|-----------|------------------|
| 8 . 9 : 00 | 9 : 35 | ゲッターリング技術 | (三菱住友シリコン) |
| 9 . 9 : 35 | 10 : 10 | SIMOX | 松村 篤樹 (ワッカー NSC) |
| 10 . 10 : 10 | 11 : 05 | SOI デバイス | 市川 文雄 (沖電気工業) |
| 11 . 11 : 05 | 11 : 10 | 閉会の挨拶 | 岸野 正剛 (姫路工大・大学院) |

注 : 学振委員以外の方のご出席も歓迎しますが、資料 (予稿集) 代として ¥ 1,000 円お支払い頂きます。